

Das wischende Entfernen nanoskaliger Verunreinigungen



Ein Vortrag von Win Labuda

I – Einführung Tücherstruktur - Handhabung - Größenverhältnisse

II – Partikel

Instrumentarium, Vier Reinigungsbeispiele, Visualisierung mit AFM-Mikroskop Oligomere aus Polyestermatrix

III – Filme

Massezunahme durch Wischvorgang, Schichtabtrag durch trockenes Wischen, Ellipsometer, chemische Rückstände im Tuch, Indikatorplatte

IV – Partikel + Filme

Kristallpartikel - mögliche Filmbildner, Filmeinbettung von 13 nm-Partikeln, Kristallisation nach Feuchtreinigung, Kristallisation nach Temperierung

IV – Untersuchungsergebnisse

Maschengebilde Reinraumtuch



REM-Fotos Yuko Labuda

30-fach

160-fach

Reinraum-Tücher

diverse Arten handgerechter Formung



Knautschball-Formung



Tampon 1-Formung





Tampon 2-Formung

Lagen-Formung

Oberflächentopografie



1 µm Topografie im Vergleich zu Nanopartikeln von 50 nm ø

menschliches Haar neben Nanopartikel



I – Einführung Tücherstruktur - Handhabung - Größenverhältnisse

II – Partikel

Instrumentarium, Vier Reinigungsbeispiele, Visualisierung mit AFM-Mikroskop Oligomere aus Polyestermatrix

III – Filme

Massezunahme durch Wischvorgang, Schichtabtrag durch trockenes Wischen, Ellipsometer, chemische Rückstände im Tuch, Indikatorplatte

IV – Partikel + Filme

Kristallpartikel - mögliche Filmbildner, Filmeinbettung von 13 nm-Partikeln, Kristallisation nach Feuchtreinigung, Kristallisation nach Temperierung

IV – Untersuchungsergebnisse

NanoSurf AFM - Atomkraft Mikroskop







AFM – Atomkraft - Mikroskop Cantilever-Spitze und Funktion



Cantilever-Spitze

Funktion des AFM

Flüssigkeits-Partikelzähler Vasco II Erfassungsbereich 0,3...6000 Nanometer



Diagramm: 13 nm Gold-Sphären in 0,5 ml DI-Wasser -Prüfung der für diese Messung verwendeten Goldpartikel auf Einhaltung der Angaben.



trockenes Wischen 1 AFM: Reinraumtuch 357 Maschen / cm²

Silikatglas, Spincoater - Auftrag





trockenes Wischen 2 AFM: Reinraumtuch 1056 Maschen / cm²

Silikatglas, Spincoater-Auftrag



nach trockenem Wischvorgang

feuchtes Wischen 1

AFM: Reinraumtuch 357 Maschen / cm²

Silikatglas, Spincoater-Auftrag



nach feuchtem Wischvorgang

feuchtes Wischen 2

AFM: Reinraumtuch 1056 Maschen / cm²

Silikatglas-Oberfläche mit Partikeln

SOum

En la

0µm



Nach feuchtem Wischvorgang

Oligomere auf Polyestermatrix Einzelfilament aus Garnstrang



I – Einführung

Tücherstruktur - Handhabung - Größenverhältnisse

II – Partikel

Instrumentarium, Vier Reinigungsbeispiele, Visualisierung mit AFM-Mikroskop Oligomere aus Polyestermatrix

III – Filme

chemische Rückstände auf Indikatorplatte, Massezunahme durch Wischvorgang, Schichtabtrag durch trockenes Wischen, Verunreinigungsrest nach Wischen

IV – Partikel + Filme

Kristallpartikel - mögliche Filmbildner, Filmeinbettung von 13 nm-Partikeln, Kristallisation nach Feuchtreinigung, Kristallisation nach Temperierung

IV – Untersuchungsergebnisse

Chemikalien-Rückstand auf Indikatorplatte Oligomere, Tenside, Spinn- und Stricköl

nach Aceton-Tränkung

nach 2-Propanol-Tränkung



Versuch: Oligomer-Darstellung

Versuch: Tensid-Darstellung

Piezoelektrische Waage - Stanford Wägebereich 0,5 - 1000 ng



Übertragung von Strick- und Spinnölresten aus einem Reinraumtuch auf die Quarzwaage



Diagramm: Gewichtszunahme eines Quarz-Kristalls nach trockenem / feuchtem Wischvorgang, Auswahl: 5 Reinraumtücher, RRT 1 - RRT 5 (Klammerwert = Maschen / cm²)

Mapping - Ellipsometer

Verunreinigungsschicht vor und nach Wischvorgang





Dr. Riss – Ellipsometer



Substrat: beschichtetes Silikatglas - Walz-Auftrag einer Öl-Schicht



Substrat: beschichtetes Silikatglas - Reinigung trockenes Reinraum-Tuch

wischendes Entfernen eines Fingerabdrucks vor und nach Abwischen





Fingerabdruck im Differential-Interferenz-Kontrast (Ausschnitt) Im DIC-Kontrast noch Rückstände im Spurenbereich sichtbar

I – Einführung

Tücherstruktur - Handhabung - Größenverhältnisse

II – Partikel

Instrumentarium, Vier Reinigungsbeispiele, Visualisierung mit AFM-Mikroskop Oligomere aus Polyestermatrix

III – Filme

chemische Rückstände auf Indikatorplatte, Massezunahme durch Wischvorgang, Schichtabtrag durch trockenes Wischen, Verunreinigungsrest nach Wischen

IV – Partikel + Filme

Kristallpartikel - mögliche Filmbildner, Filmeinbettung von 13 nm-Partikeln, Kristallisationen und Tröpfchenbildung

IV – Untersuchungsergebnisse

Polyester-Filamente nach Dekontamination Tensid-Rückstände in kristalliner Form



— 6,2 µm —

AFM-Scan – nach Ultra-Reinigung z.B Piranha etch und O2-Plasma



AFM-Scan - nach feuchtem Wischen mit Reinraumtuch



Die 13 nm-Gold-Sphären sind deutlich eingebettet in eine organische Schicht.

AFM-Scan - nach feuchtem Wischen mit Reinraumtuch und 30 min Wärmebehandlung



Die 13 nm Gold-Sphären sind eingebettet in eine organische Schicht mit deutlichen Kristallfiguren oben rechts.

AFM-Scan - feuchtes Wischen mit Reinraumtuch der Maschenzahl 1056



Tröpchenbildung auf der Oberfläche

AFM-Scan nach feuchtem Wischen mit Reinraumtuch der Maschenzahl 1056



Kristallisation von etwa 6 µm Durchmesser, Vergrößerung = 10.000-fach

I – Einführung

Tücherstruktur - Handhabung - Größenverhältnisse

II – Partikel

Instrumentarium, Vier Reinigungsbeispiele, Visualisierung mit AFM-Mikroskop Oligomere aus Polyestermatrix

III – Filme

chemische Rückstände auf Indikatorplatte, Massezunahme durch Wischvorgang, Schichtabtrag durch trockenes Wischen, Verunreinigungsrest nach Wischen

IV – Partikel + Filme

Kristallpartikel - mögliche Filmbildner, Filmeinbettung von 13 nm-Partikeln, Kristallisationen und Tröpfchenbildung

IV – Untersuchungsergebnisse

Untersuchungs-Ergebnisse

- 50 nm Partikel durch Reinraumtücher effizient entfernbar.
- 10 nm Partikel durch Reinraumtücher nur begrenzt entfernbar.
- Zunehmende Oberflächenrauigkeit ergibt abnehmender Reinigungseffizienz.
- Oligomere = Aus der Polyestermatrix ausgelöste Nanopartikel.
- Ölschichten bis zu etwa 5 nm Dicke durch Reinraumtücher entfernbar.
- feuchte Tücher haben im Nanobereich ein hohes Verunreinigungs-Potenzial.
- Feuchtreinigung führt evtl. zu Mikro Kristallisationen auf der Oberfläche.
- Die Abreinigung von Nanopartikeln und Schichten erfordert spezielle Tücher.

Instrumentarium und Hilfsmittel

- Atomkraft-Mikroskop Naio-AFM
- Gold-Sphären 13 und 50 nm, Quantum dots
- Dr.-Riss-Ellipsometer
- Nano-Partikel-Zähler
- Picogramm-Quarzwaage

Nanosurf GmbH - Langen CAN GmbH - Hamburg Dr. Riss Ellipsometerbau GmbH - Ratzeburg Cordouan Technologies, Pessac, France (Schäfer-Technologie GmbH - Langen) Stanford Research Systems Inc., USA

Dank

• Wir danken den jeweiligen Beratungs-Ingenieuren der o.g. Hersteller für ihre Beratung: Herrn Dr. Marcus Weth (Nanosurf), Frau Katja Werner (CAN), Herrn Dr. Udo Riss (DRE), Herrn Dr. Lars Jansen (Schäfer) und Mr. Dave Ames (Stanford)

• Für die Beratung im Bereich der Laboranalytik und der Oligomerenbildung danken wir Herrn Dr. Dierck Knittel. Für die grafische Gestaltung Dank an Frau Cora Ipsen, für die REM-Bilder an Frau Yuko Labuda.

• Unser größter Dank gilt jedoch Herrn Martin Gerstmann vom Clear & Clean -Forschungslabor. Ohne seine engagierte Laborarbeit würde die vorliegende Arbeit nicht in dieser detaillierten Form vorliegen.